

MEMBRANA RO VONTRON / ULTRA BAJA PRESION 11000 GPD / 150 PSI

REF; FIL-ULP21-8040



VONTRON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA
www.filsawater.com

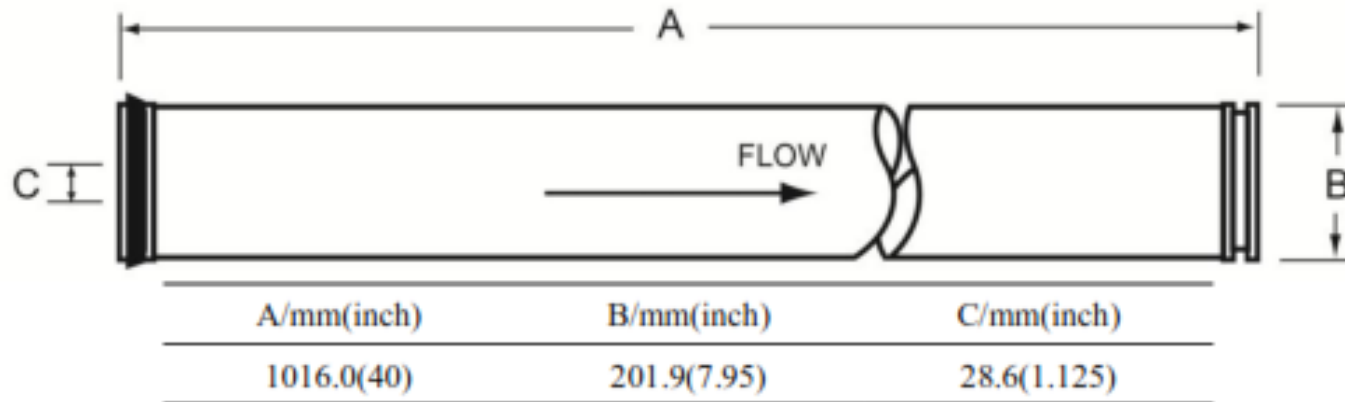
MEMBRANA RO VONTRON / ULTRA BAJA PRESION 11000 GPD / 150 PSI

REF; FIL-ULP21-8040

La serie ULP de elemento de membrana de compuesto de poliamida aromática de presión ultrabaja recientemente desarrollada por Vontron, puede trabajar bajo presión ultra baja para alcanzar un flujo y rechazo de permeado tan alto como el elemento de membrana de baja presión regular, y es aplicable a desalinización de aguas superficiales y subterráneas. Opera con aproximadamente dos tercios de la presión operativa de las membranas compuestas de baja presión, lo que puede disminuir los costos de inversión para instalaciones relevantes como bombas, tuberías y contenedores, etc. y el costo de operación para el sistema RO, aumentando así la eficiencia económica.

Aplicable al tratamiento de desalinización de esas fuentes de agua con NaCl inferior a 2000 ppm, como agua superficial, agua subterránea, agua corriente y agua municipal, los elementos de membrana de la serie ULP son principalmente aplicables a agua pura, reposición de agua de caldera, procesamiento de alimentos y producción farmacéutica.

Size of Membrane Element: 1.0 inch-25.4 mm



MEMBRANA RO VONTRON / ULTRA BAJA PRESION 11000 GPD / 150 PSI

REF; FIL-ULP21-8040

Modelo	Nominal de Membrana Area ft ² (m ²)	Flujo de Permeado GPD(m ³ /d)	Rechazo de sales Valor %	Min. Rechazo Valor %
ULP21-8040	365 (33,9)	11000 (41,6)	99.0	98.5

Condicion de prueba	Presión de Prueba	150 psi (1.03MPa)
	Prueba de temperatura	25 °C
	Concentración de la solución de pruebas (NaCl)	1500ppm
	pH valor de solución de pruebas	7.5
	Tasa de recuperación del elemento individual	15%
Operacion	Max. Presion aplicada	600psi (4.14MPa)
	Max. Flujo de alimentacion	75gpm (17 m ³ /h)
	Max. Temperatura de operacion	45°C
	Max. Agua alimentación	5
Limites & Condiciones	pH Rango de agua de alimentación durante la operación continua	3~10
	pH Rango de agua de alimentación durante la limpieza química	2~12
	Concentración de cloro residual del agua de alimentación	<0.1ppm
	Max. Caída de presión del elemento de membrana individual	15psi (0.1MPa)
	Max. Caída de presión del recipiente de presión simple con seis	

ANTI – FALSIFICACION VONTRON

La primera forma

Digite los 20 dígitos anti-fake <http://track.vontron.com/>

RESIDENCIAL



20-digits new Anti-fake Code

INDUSTRIAL



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA COLOMBIA
www.filsawater.com

